



www.ix-factory.de

Lithographische Prozessoptimierung unterschiedlicher Substrate

Das Praktikum ist bereits vergeben.

Beschreibung:

Die Lithographie ist das Herzstück einer jeden Fertigungslinie. Sowohl für das Nass- oder Trockenätzen, als auch für das Sandstrahlen werden lithographisch erzeugte Masken benötigt. Dabei werden je nach Anforderungen unterschiedliche Lacke eingesetzt.

Die Aufgabe dieses Praktikums besteht darin unterschiedliche Substrate und Substratgrößen mit den verschiedenen Lacken und Schichtdicken herzustellen. Die Optimierung der Belichtungsprozesse mit senkrechten Seitenwänden gehört ebenfalls zur Aufgabenstellung.

Aufgaben:

Einarbeitung an den Prozessanlagen Lackschleuder und Belichter
Durchführung von Prozessreihen auf Silizium und Glas, runden und eckigen Substraten auf unterschiedlichen Größen
Optimierung der Belichtungsparameter der verschiedenen Lacke und Schichtdicken
Erweiterung der Versuchsreihen auf unterschiedlichen Dünnschichtmaterialien
Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Abschlussbericht

Zielgruppe:

Student/in einer technischen, chemischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtung

Termin / Zeitraum:

Ab sofort / min. 6 Wochen

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen per Post:

iX-factory GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 11
D-44263 Dortmund

oder per E-Mail:

jobs@ix-factory.de